

表 B-1：

台聯大奈科中心－儀器設備自行操作開放等級分類

儀器設備名稱	開放等級	助理
高溫氧化爐管	A	自強基金會
磷擴散爐管	A	自強基金會
硼擴散爐管	A	自強基金會
退火爐管	A	自強基金會
四點針測	A	自強基金會
薄膜量測儀	A	自強基金會
顯微鏡及照像系統	A	自強基金會
電漿光阻去除系統	A	自強基金會
電子鎗真空蒸鍍系統 (E-Gun System)	B	陳許峻
直流式真空濺鍍系統(DC-Sputter System)	B	王興祥
雙面曝光對準系統 (Double-Side Aligner)	B	洪錦石
矽 -- 玻璃陽極接合技術 (Andoic Bonding System)	B	洪錦石
介電層反應離子蝕刻系統 (Dielectric RIE - 10NR)	B	王興祥
二氧化碳乾式清洗系統(CO ₂ Dryer)	B	陳許峻
高分子化學氣相沉積系統(Parylene Coating)	B	陳許峻
TMAH 濕蝕刻系統(TMAH Etching System)	B	鄒紹光
電漿輔助化學氣相沉積 (PECVD System)	C	王興祥
矽等向蝕刻系統 (XeF ₂ Si Isotropic Etching)	C	陳許峻
電感耦合電漿式矽蝕刻系統 (ICP)	C	洪錦石
金屬反應離子蝕刻系統 (Metal RIE -200L)	C	王興祥
低壓化學氣相沉積系統 (LPCVD System)	C	鄒紹光
射頻濺鍍系統 (RF-Sputter System)	D	鄒紹光
雷射圖形產生器(Laser Mask Maker)	E	陳許峻
密集式沈積與蝕刻系統(RIE & PECVD, P5000)	E	鄒紹光

博士後研究員：陳建亨、岑尚仁

行政助理：林瑟蘭 03-5742264

等級 A：洽自強基金會

等級 B：人數不限

等級 C：每一 Group 限研究生三人（至少一人為博士班）

等級 D：限博士班學生

等級 E：由奈科中心指定